

UCHWAŁA
Komisji habilitacyjnej
z dnia 23.02.2024 r.

powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika
i technologie kosmiczne w postępowaniu wszczętym na wniosek dr. inż. Ralfa Stettera

§ 1

Komisja habilitacyjna powołana w dniu 27.09.2023 r. przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, działając na podstawie art. 221 ust. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 555 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Zielonogórskim, po zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją wniosku stwierdza, że aktywność naukowa oraz osiągnięcie naukowe zatytułowane „**Projektowanie i sterowanie tolerujące uszkodzenia dla inteligentnych systemów technicznych**” stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej **automatyka, elektronika, elektrotechnika, i technologie kosmiczne** i wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania dr. inż. Ralfowi Stetterowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk **inżynieryjno-technicznych**, w dyscyplinie **automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne**.

Uzasadnienie:

1. Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie w dniu 23.03.2023 r.
2. Uchwała została podjęta 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami „wstrzymującymi się”,
3. Recenzje o dorobku naukowym i aktywności naukowej doktora inż. Ralfa Stettera, sporządzone przez czterech Recenzentów mają jednoznacznie pozytywne konkluzje.
4. Osiągnięcie naukowe zatytułowane „*Projektowanie i sterowanie tolerujące uszkodzenia dla inteligentnych systemów technicznych*” oraz pozostałe elementy dorobku naukowego, a w szczególności:

- opublikowanie 6 rozdziałów w monografiach
- opublikowanie artykułów w czasopismach z listy JCR (m.in. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Sensors, Applied Sciences)
- autorstwo lub współautorstwo 112 referatów opublikowanych w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych,
- autorstwo lub współautorstwo 11 patentów lub zgłoszeń patentowych (Niemcy),
- kierowanie 4 projektami badawczymi oraz udział w 4 projektach badawczych,
- satysfakcjonujące wskaźniki bibliometryczne według Web of Science (sumaryczny impact factor IF = 37, indeks Hirscha = 9; liczba cytowań WoS= 278, Scopus=557, Google Scholar=1081),

wnoszą znaczny wkład habilitanta w rozwój dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

5. Dorobek w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz współpracy międzynarodowej, obejmujący m.in. takie elementy jak:

- udział w wielu programach europejskich, międzynarodowych, krajowych,
- udział w ponad 100 konferencjach,
- opracowanie 116 recenzji dla prestiżowych czasopism krajowych i zagranicznych o zasięgu międzynarodowym,
- opracowanie recenzji referatów konferencji krajowych i międzynarodowych,
- udział w 18 komitetach redakcyjnych,
- staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, w tym m.in. na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz istotny dorobek naukowy będący wynikiem działalności naukowej w tych ośrodkach,
- współpraca z polskim środowiskiem naukowym i wielokrotne pełnienie funkcji promotora pomocniczego na uczelniach technicznych w Polsce,
- opieka naukowa nad studentami zagranicznymi (program Erasmus),
- prowadzenie autorskich wykładów i inne osiągnięcia dydaktyczne, w tym kierowanie 272 pracami dyplomowymi (189 pierwszego stopnia i 83 drugiego stopnia),
- działalność w zakresie popularyzacji nauki, wyrażająca się m.in. współpracą z kołami naukowymi,

w sposób jednoznaczny świadczy o wysokiej aktywności zawodowej habilitanta.

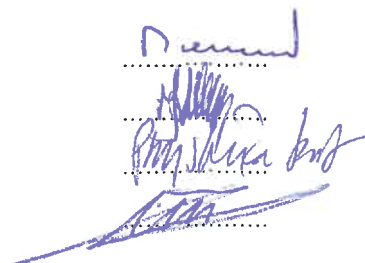
[zgodnie z art. 221 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) uchwała komisji habilitacyjnej musi zawierać uzasadnienie; uzasadnienie do uchwały może być zawarte w załączniku nr 1 do uchwały; stanowiącym integralną jej część]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy członków Komisji Habilitacyjnej:

1. prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, recenzent
3. dr hab. inż. Piotr Stanisław Przysłanka, prof. PŚ, recenzent
4. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk, recenzent



5. prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz, recenzent
6. prof. dr hab. inż. Robert Smoleński, członek komisji
7. dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski, prof. UZ, sekretarz

A. Bartoszewicz
.....
.....
B.S.